

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【公開番号】特開2005-208465(P2005-208465A)

【公開日】平成17年8月4日(2005.8.4)

【年通号数】公開・登録公報2005-030

【出願番号】特願2004-16730(P2004-16730)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/037 (2006.01)

C 0 8 G 73/10 (2006.01)

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

G 0 3 F 7/022 (2006.01)

G 0 3 F 7/40 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/037

C 0 8 G 73/10

G 0 3 F 7/004 5 0 1

G 0 3 F 7/022

G 0 3 F 7/40 5 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月13日(2009.2.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 5 6 】

市販されている化合物としては、酸化スズ - 酸化チタン複合粒子の " オプトレイク T R - 5 0 2 "、" オプトレイク T R - 5 0 4 "、酸化ケイ素 - 酸化チタン複合粒子の " オプトレイク T R - 5 0 3 "、" オプトレイク T R - 5 1 2 "、" オプトレイク T R - 5 1 3 "、" オプトレイク T R - 5 1 4 "、" オプトレイク T R - 5 1 5 "、酸化チタン粒子の " オプトレイク T R - 5 0 5 "（以上、商品名、触媒化成工業（株）製）、酸化ジルコニウム粒子（（株）高純度化学研究所製）、酸化スズ - 酸化ジルコニウム複合粒子（触媒化成工業（株）製）、酸化スズ粒子（（株）高純度化学研究所製）等が挙げられる。